

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 25 年 5 月 30 日 (2013.5.30)

【公開番号】特開 2012-232591 (P2012-232591A)

【公開日】平成 24 年 11 月 29 日 (2012.11.29)

【年通号数】公開・登録公報 2012-050

【出願番号】特願 2012-149041 (P2012-149041)

【国際特許分類】

B 3 2 B 27/00 (2006.01)

B 3 2 B 27/16 (2006.01)

B 0 5 D 7/24 (2006.01)

B 0 5 D 3/04 (2006.01)

C 2 3 C 14/20 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 27/00 1 0 1

B 3 2 B 27/16

B 0 5 D 7/24 3 0 2 Y

B 0 5 D 3/04 C

C 2 3 C 14/20 B

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 4 月 12 日 (2013.4.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ポリマー基材 (10) と、

式 $R_2Si(OR')_2$ のジオルガノジオルガノオキシシラン、式 $RSi(OR')_3$ のオルガノトリオルガノオキシシラン又は両者の部分縮合物を含んでなる第一の層 (20) (式中、R は独立に炭素原子数約 1 ~ 3 のアルキル基、炭素原子数約 6 ~ 13 の芳香族基、ビニル基、3, 3, 3 - トリフルオロプロピル基、- グリシドキシプロピル基及び - メタクリロキシプロピル基からなる群から選択され、R' は独立に炭素原子数約 1 ~ 8 のアルキル基、炭素原子数約 6 ~ 20 の芳香族基及び水素からなる群から選択される。) と、

プラズマ中で重合及び酸化した有機ケイ素材料を含んでなる第二の層 (30) であって、ケイ素、酸素、炭素及び水素を含み、過剰の酸素の存在下で $10^6 \sim 10^8$ J / Kg のパワーレベルで第一の層の上に堆積した第二の層 (30) とを含んでなる多層品。

【請求項 2】

ポリマー基材 (10) と、

式 $R_2Si(OR')_2$ のジオルガノジオルガノオキシシラン、式 $RSi(OR')_3$ のオルガノトリオルガノオキシシラン又は両者の部分縮合物を含んでなる第一の層 (20) (式中、R は独立に炭素原子数約 1 ~ 3 のアルキル基、炭素原子数約 6 ~ 13 の芳香族基、ビニル基、3, 3, 3 - トリフルオロプロピル基、- グリシドキシプロピル基及び - メタクリロキシプロピル基からなる群から選択され、R' は独立に炭素原子数約 1 ~ 8 のアルキル基、炭素原子数約 6 ~ 20 の芳香族基及び水素からなる群から選択される。) と、

プラズマ中で重合及び酸化した有機ケイ素材料を含んでなる第二の層（３０）であって、ケイ素、酸素、炭素及び水素を含み、第一の層の上に堆積した第二の層（３０）と含んでなる多層品であって、当該多層品がキセノンアークウェザロメータ中ＡＳＴＭ Ｇ ２ ６ サイクルで ６ ８ ７ ５ k J / m² の放射線照射後に実質的に微小亀裂のない状態に留まる多層品。

【請求項 ３】

第一の層（２０）が紫外線吸収剤をさらに含んでなる請求項 １ 又は ２ 記載の多層品。

【請求項 ４】

第一の層（２０）の厚さが １ ～ １ ５ ミクロンである請求項 １ 又は ２ 記載の多層品。

【請求項 ５】

第二の層（３０）の厚さが ０．５ ～ ５．０ ミクロンである請求項 １ 又は ２ 記載の多層品

。

【請求項 ６】

基材（１０）と第一の層（２０）との間にプライマー層（１５）をさらに含んでなる請求項 １ 又は ２ 記載の多層品。

【請求項 ７】

有機ケイ素材料の単量体が、テトラメチルジシロキサン、ヘキサメチルジシロキサン及びオクタメチルシクロテトラシロキサンの １ 以上を含んでなる請求項 １ 又は ２ 記載の多層品。